

GAV 2871
#3

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of
FUJIMORI et al.

Serial No. 09/759,334

Filed: January 16, 2001

For: LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE



Atty. Ref.: 3693-12

Group: 2871

Examiner: unknown

Priority Papers
M. Brunsm
4/18/01

* * * * *

Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Sir:

It is respectfully requested that this application be given the benefit of the foreign filing date under the provisions of 35 U.S.C. §119 of the following, a certified copy of which is submitted herewith:

<u>Application No.</u>	<u>Country of Origin</u>	<u>Filed</u>
2000-008769	Japan	18 January 2000
2000-362208	Japan	29 November 2000

Respectfully submitted,

NIXON & VANDERHYE P.C.

March 9, 2001

By: H. Warren Burnam
H. Warren Burnam, Jr.
Reg. No. 29,366

HWB:lsh
1100 North Glebe Road, 8th Floor
Arlington, VA 22201-4714
Telephone: (703) 816-4000
Facsimile: (703) 816-4100

TE 2600 MAIL ROOM
4/13/2001
NIXON & VANDERHYE

日本特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2000年 1月 18日

出願番号

Application Number:

特願2000-008769

出願人

Applicant(s):

シャープ株式会社

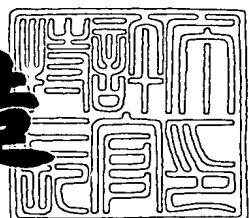


出願番号
特許登録番号
2000-008769
2000-3091927

2000年 11月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3091927

【書類名】 特許願
【整理番号】 99J03380
【提出日】 平成12年 1月18日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G02F 1/133
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
【氏名】 藤森 孝一
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
【氏名】 久保 真澄
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
【氏名】 鳴瀧 陽三
【特許出願人】
【識別番号】 000005049
【氏名又は名称】 シャープ株式会社
【代理人】
【識別番号】 100077931
【弁理士】
【氏名又は名称】 前田 弘
【選任した代理人】
【識別番号】 100094134
【弁理士】
【氏名又は名称】 小山 廣毅

【選任した代理人】

【識別番号】 100110939

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹内 宏

【選任した代理人】

【識別番号】 100110940

【弁理士】

【氏名又は名称】 嶋田 高久

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014409

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1基板と、第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた液晶層とを有し、表示を行うための複数の絵素領域を有する液晶表示装置であって、

前記複数の絵素領域のそれぞれは、前記第1基板から入射する光を用いて透過モードで表示を行う透過領域と、前記第2基板側から入射する光を用いて反射モードで表示を行う反射領域とを有し、

前記第1基板は、前記液晶層側に、前記透過領域を規定する透明電極領域と、前記反射領域を規定する反射電極領域とを有し、且つ、前記第1基板の前記透過電極領域および前記反射電極領域の前記液晶層側の表面はそれ平坦であり、

前記第2基板は、前記反射領域に光拡散層を有し、前記液晶層側の前記反射領域および前記透過領域に透明電極を有し、且つ、前記第2基板の前記液晶層側の表面は前記透過領域内および前記反射領域内でそれ平坦である液晶表示装置。

【請求項2】 前記第2基板は、前記透過領域にも前記光拡散層を有する請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記第2基板は、前記反射領域にのみ前記光拡散層を有する請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記第2基板は透明基板を有し、前記光拡散層は前記透明基板の前記液晶層側に設けられている請求項1から3のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記第2基板は透明基板を有し、前記光拡散層は前記透明基板の観察者側に設けられている請求項1から3のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記第2基板の観察者側に偏光板をさらに有し、

前記光拡散層は前記透明基板と前記偏光板との間に設けられている請求項5に記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記光拡散層は、前記透明基板と前記偏光板とを互いに接着する接着層として機能する請求項6に記載の液晶表示装置。

【請求項8】 前記光拡散層は、マトリクス材料と、前記マトリクス材料の屈折率と異なる屈折率を有する粒子とを含む請求項1から7のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項9】 前記第2基板は、透明基板とカラーフィルタ層とを有し、前記カラーフィルタ層は、前記光拡散層としても機能する請求項1または2のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項10】 前記第2基板は、プラスチック基板を有し、前記プラスチック基板は、マトリクス材料と、前記マトリクス材料の屈折率と異なる屈折率を有する粒子とを含み、前記プラスチック基板が前記光拡散層としても機能する請求項1または2に記載の液晶表示装置。

【請求項11】 前記光拡散層は前記反射領域内の前記液晶層の厚さは、前記透過領域の前記液晶層の厚さの2分の1である請求項1から10のいずれかに記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶表示装置に関し、特に透過モードによる表示と反射モードによる表示とが可能な透過反射両用型の液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、液晶表示装置は、薄型で低消費電力であるという特徴を生かして、ワードプロセッサやパーソナルコンピュータなどのOA機器、電子手帳などの携帯情報機器、あるいは液晶モニターを備えたカメラ一体型VTRなどに広く用いられている。

【0003】

これらの液晶表示装置は反射型と透過型に大別される。液晶表示装置は、CRT（ブラウン管）やEL（エレクトロルミネッセンス）などの自発光型の表示装置

ではなく、透過型は、液晶表示パネルの背後に配置された照明装置（いわゆるバックライト）の光を用いて表示を行い、反射型は、周囲光を用いて表示を行っている。

【0004】

透過型液晶表示装置は、バックライトからの光を用いて表示を行うので、周囲の明るさに影響されることが少なく、明るい高コントラスト比の表示を行うことができるという利点を有しているものの、バックライトを有するので消費電力が大きいという問題を有している。通常の透過型液晶表示装置の消費電力の約50%以上がバックライトによって消費される。また、非常に明るい使用環境（例えば、晴天の屋外）においては、視認性が低下してしまうか、あるいは、視認性を維持するためにバックライトの輝度を上げると消費電力がさらに増大するという問題があった。

【0005】

一方、反射型液晶表示装置は、バックライトを有しないので、消費電力を極めて小さいという利点を有しているものの、表示の明るさやコントラスト比が周囲の明るさなどの使用環境によって大きく左右されるという問題を有している。特に、暗い使用環境においては視認性が極端に低下するという欠点を有している。

【0006】

そこで、こうした問題を解決できる液晶表示装置として、反射型と透過型との両方のモードで表示する機能を持った液晶表示装置が、例えば特開平11-1101992号公報に開示されている。

【0007】

この透過反射両用型液晶表示装置は、1つの絵素領域に、周囲光を反射する反射用絵素電極と、バックライトからの光を透過する透過用絵素電極とを有しており、使用環境（周囲の明るさ）に応じて、透過モードによる表示と反射モードによる表示との切り替え、または両方の表示モードによる表示を行うことができる。従って、透過反射両用型液晶表示装置は、反射型液晶表示装置が有する低消費電力という特徴と、透過型液晶表示装置が有する周囲の明るさに影響されることなく、明るい高コントラスト比の表示を行うことができるという特徴とを兼

ね備えている。さらに、非常に明るい使用環境（例えば、晴天の屋外）において視認性が低下するという透過型液晶表示装置の欠点も抑制される。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特開平11-101992号公報に開示されている両用型液晶表示装置は、反射モードによる表示の輝度を向上するために、反射電極の表面に凹凸を形成しており（例えば、上記公報の図6および図9）、その結果、反射領域内の液晶層の厚さのばらつきが特に大きく、最適な表示を実現するのが困難であった。また、凹凸による光の干渉を防止するためには、凹凸の形状を正確に制御する必要があり、製造コストが上昇するという問題もあった。

【0009】

本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、その主な目的は、液晶層の厚さ、特に反射領域内の液晶層の厚さを正確に制御することが可能で、高品位の表示を実現できる透過反射両用型の液晶表示装置を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】

本発明の液晶表示装置は、第1基板と、第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた液晶層とを有し、表示を行うための複数の絵素領域を有する液晶表示装置であって、前記複数の絵素領域のそれぞれは、前記第1基板から入射する光を用いて透過モードで表示を行う透過領域と、前記第2基板側から入射する光を用いて反射モードで表示を行う反射領域とを有し、前記第1基板は、前記液晶層側に、前記透過領域を規定する透明電極領域と、前記反射領域を規定する反射電極領域とを有し、且つ、前記第1基板の前記透過電極領域および前記反射電極領域の前記液晶層側の表面はそれぞれ平坦であり、前記第2基板は、前記反射領域に光拡散層を有し、前記液晶層側の前記反射領域および前記透過領域に透明電極を有し、且つ、前記第2基板の前記液晶層側の表面は前記透過領域内および前記反射領域内でそれぞれ平坦であり、そのことによって上記目的が達成される。

【0011】

前記第2基板が前記透過領域にも前記光拡散層を有する構成としてもよい、あるいは、前記第2基板が前記反射領域にのみ前記光拡散層を有する構成としてもよい。

【0012】

前記第2基板は透明基板を有し、前記光拡散層は前記透明基板の前記液晶層側に設けられている構成としてもよし、あるいは、前記光拡散層は前記透明基板の観察者側（液晶層側とは反対側）に設けられている構成としてもよい。

【0013】

前記第2基板の観察者側に偏光板を有する液晶表示装置であって、前記光拡散層が観察者側にもけられた構成においては、前記光拡散層は前記透明基板と前記偏光板との間に設けられていることが好ましい。さらに、前記光拡散層は、前記透明基板と前記偏光板とを互いに接着する接着層として機能することが好ましい。

【0014】

前記光拡散層は、マトリクス材料と、前記マトリクス材料の屈折率と異なる屈折率を有する粒子とを含む、分散系光拡散層であることが好ましい。

【0015】

前記第2基板が、透明基板とカラーフィルタ層とを有し、前記カラーフィルタ層は、前記光拡散層としても機能する構成としてもよい。

【0016】

前記第2基板は、プラスチック基板を有し、前記プラスチック基板は、マトリクス材料と、前記マトリクス材料の屈折率と異なる屈折率を有する粒子とを含み、前記プラスチック基板が前記光拡散層としても機能する構成としてもよい。

【0017】

前記光拡散層は前記反射領域内の前記液晶層の厚さは、前記透過領域の前記液晶層の厚さの2分の1であることが好ましい。

【0018】

以下、本発明の作用を説明する。

【0019】

本発明による液晶表示装置を構成する第1基板（バックライト側に配置される基板、例えばアクティブマトリクス基板）および第2基板（観察者側に配置される基板、例えばカラーフィルタ基板）の液晶層側の表面は、反射領域および透過領域のそれぞれの領域内で、平坦なので、それぞれの領域内の液晶層は一定の厚さを有する。従って、反射領域および透過領域のそれぞれの領域の液晶層の厚さをそれぞれの表示モードに最適の厚さに設定することができる。第2基板の反射領域に設けられた光拡散層は、反射領域に入射する光を拡散するので、ペーパホワイトの白表示を実現することができる。

【0020】

本願明細書において、「平坦」とは、液晶層の厚さのばらつきに起因する表示品位の低下が発生しない程度に、液晶層の厚さを均一に規定する表面の状態を言う。具体的には、ある領域の表面の粗さ（例えば表面粗さ計で測定された凹凸の平均値）が、その領域の液晶層の厚さの10分の1以下であるとき、その表面は平坦であるという。平坦な表面は鏡面である必要はない。

【0021】

また、光拡散層を第2基板の透過領域に形成すると、透過領域を透過する光が拡散されることによって、液晶表示装置の透過領域における表面反射が抑制され、ざらつきやぎらつきのない表示を実現することができる。すなわち、透過領域に設けられた光拡散層は、いわゆる、アンチグレア効果を発揮する。一方、透過領域に光拡散層を設けない構成においては、透過領域における光の利用効率が向上する。いずれの構成を採用するかは、液晶表示装置の用途に応じて適宜決定すればよい。

【0022】

また、光拡散層は、第2基板の液晶層側（「内側」とも称する）に設けてもよいし、逆に観察者側（「外側」とも称する）に設けてもよい。いずれの構成を採用するかは、以下に説明するそれぞれの構成の利点と欠点とを考慮し、液晶表示装置の用途に応じて適宜決定すればよい。

【0023】

光拡散層を内側に設けた構成は、表示画像のぼやけ（輪郭が不鮮明になる現象）が生じにくいという利点がある反面、製造工程が複雑となりコストが上昇するという欠点がある。また、光拡散層を反射領域に選択的に配置する構成において、光拡散層の配置パターンのピッチが画素ピッチと近いと、光の干渉（モアレ）が生じやすいという問題があり、この問題は高精細な液晶表示装置で顕著となる。

【0024】

一方、光拡散層を外側に設けた構成は、製造が容易で、設計変更や共用化に対応しやすく、低コストで製造できるという利点がある反面、表示画像のぼやけが生じやすいという欠点がある。表示画像のぼやけを抑制するために、薄い基板を用いることが好ましい。なお、光拡散層を外側に配置しても、反射層を基板の外側に配置した場合に生じる2重写りの問題は生じない。これは、光拡散層は反射層と異なり、入射光を正反射しないからである。

【0025】

さらに、第2基板を構成する透明基板の観察者側に偏光板を有する液晶表示装置において、光拡散層を外側に設ける構成を採用する場合、光散乱層を透明基板と偏光板との間に配置することによって、表示画像のぼやけを最低限に抑制することができる。また、偏光板と透明基板とを互いに接着するための接着剤に光散乱機能を有する材料を用いることによって、製造工程を簡略化することができる。

【0026】

光拡散層は、透明層または基板の表面を粗面化することによっても形成できるが、マトリクス中にマトリクスの屈折率と異なる屈折率を有する粒子（充填剤）を分散することによって形成することが好ましい。光拡散層をマトリクス中に粒子を分散した材料を用いて形成すると、表面が平坦な光拡散層を容易に形成できるとともに、反射領域の液晶層の厚さを容易に且つ正確に制御することができる。液晶表示装置の第2基板がカラーフィルタ層を有する場合には、カラーフィルタ層を形成するマトリクス材料に、マトリクス材料の屈折率と異なる屈折率を有する粒子を分散することによって、カラーフィルタ層を光拡散層としても機能さ

せることができ、液晶表示装置の製造プロセスを簡略化することができる。また、プラスチック基板を用いる場合には、プラスチック基板を形成するマトリクス材料に、マトリクス材料の屈折率と異なる屈折率を有する粒子を分散することによって、プラスチック基板を光拡散層としても機能させることができ、液晶表示装置の製造プロセスを簡略化することができる。

【0027】

偏光を用いた表示モード（単に「偏光モード」とも言う。）を行う液晶表示装置においては、反射領域の液晶層の厚さを透過領域の液晶層の厚さの2分の1とすることによって、反射領域を通過する光のリタデーションを透過領域を通過する光のリタデーションと一致させることができ、且つ、それぞれの領域における液晶層の厚さが一定なので、高品位の表示を実現することができる。

【0028】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照ながら本発明の実施形態を説明する。なお、本発明は以下の実施形態によって限定されるものではない。

【0029】

(実施形態1)

実施形態1の液晶表示装置は、第1基板（バックライト側）に液晶層を間に介して対向するように配設された第2基板（観察者側）の内側（液晶層側）に光拡散層が配置されている。

【0030】

本発明による実施形態1の液晶表示装置100および100'の模式的な断面構造を図1(a)および(b)に示す。図1(a)および(b)は、それぞれ本発明による液晶表示装置100および100'の断面図であり、図2は、液晶表示装置100および100'が有するアクティブマトリクス基板100Aの平面図を示す。

【0031】

透過反射両用型の液晶表示装置100および100'は、図1(a)および(b)に示したように、マトリクス状に配列された複数の絵素領域Pxごとに透過

領域T_rと反射領域R_fとを有しており、透過モードおよび反射モードで表示を行うことができる。透過モードおよび反射モードのいずれか一方のモードで表示を行うことも可能で、両方のモードで表示を行うこともできる。典型的には、液晶表示装置100および100'は、その両側に平行ニコルに配置された一対の偏光板（不図示）と、アクティブマトリクス基板100A側に設けられた照明装置（バックライト、不図示）とを有している。なお、図1(a)および(b)は、1つの絵素領域P_xを示している。図1(b)に示した液晶表示装置100'は、光拡散層30の構成が図1(a)に示した液晶表示装置100と異なる。

【0032】

図1(a)に示したように、液晶表示装置100は、アクティブマトリクス基板100Aと対向基板（「カラーフィルタ基板」とも言う。）100Bと、これらの間に設けられた液晶層24とを有している。

【0033】

アクティブマトリクス基板100Aは、図2に示したように、液晶表示装置100の透過領域T_rを規定する透明電極領域20と、反射領域R_fを規定する反射電極領域22とを有している。絵素領域P_xは透過領域T_rと反射領域R_fとから構成され、絵素電極領域1は透明電極領域20と反射電極領域22とから構成されている。絵素電極領域1、透明電極領域20および反射電極領域22は、アクティブマトリクス基板100Aの領域として定義され、絵素領域P_x、透過領域T_rおよび反射領域R_fは、液晶表示装置100の領域として定義される。

【0034】

透明電極領域20は、透明電極21を有し、反射電極領域は金属層23を有している。金属層23は透明電極21と接触して形成されており、金属層23は透明電極21を介してTFT4のドレイン電極16に電気的に接続されており、反射電極として機能する。すなわち、透明電極21と金属層23とが絵素電極として機能する。透明電極21は、例えばITOなどの透明導電材料から形成され、金属層23は、例えば、Alなどの高反射率金属から形成される。

【0035】

なお、一般に、反射電極領域22を規定する金属層23はドレイン電極16と

電気的に接続される必要は無く、金属層23自身が反射電極として機能する必要はない。例えば、金属層23の下部に絶縁層（不図示）を設けて、別途形成した透明電極を用いて、反射領域Rf内の液晶層24に電圧を印加する構成にしても良い。

【0036】

図1(a)に示したように、アクティブマトリクス基板100Aは、ガラス基板などの透明絶縁性基板11を有し、この透明基板11上に、ゲート配線2、ゲート電極12および補助容量電極8が形成されている。さらに、これらを覆うようにゲート絶縁膜2が形成されている。ゲート電極12上に位置するゲート絶縁膜2上に、半導体層13、チャネル保護層14、ソース電極15およびドレイン電極16が形成されており、これらが、TFT4を構成している。TFT4のソース電極15はソース配線3に、ドレイン電極16は接続電極5に、それぞれ電気的に接続されている。ソース電極15およびドレイン電極16は、いずれも、透明導電層17および金属層18とからなる2層構造を有している。

【0037】

TFT4が形成された透明基板11の表面のほぼ全面を覆うように層間絶縁膜19が形成されており、層間絶縁膜19の表面は平坦化されている。この層間絶縁膜19の平坦な表面に、透明電極21が形成されており、透明電極21上に金属層23が形成されている。透明電極21は層間絶縁膜19に設けられたコンタクトホール6において接続電極5と電気的に接続され、接続電極5を介してドレイン電極16に電気的に接続されている。金属層23は、透明電極21を介して、ドレイン電極16に電気的に接続されている。

【0038】

層間絶縁膜19を形成することによって、基板100Aの表面を平坦にするとともに、下部に形成されたTFT4や種々の配線と金属層23とを絶縁できるので、TFT4やゲート配線2、ソース配線3および接続電極5の上部にも金属層23を形成することが可能となり、それによって表示面積を増加することができる。

【0039】

なお、アクティブマトリクス基板100Aは一例に過ぎず、TFT4の構成や接続電極5の構成は適宜変更できる。また、透明電極領域20および反射電極領域22のそれぞれの液晶層24側の表面が平坦であれば、公知の他のアクティブマトリクス基板を広く適用できる。

【0040】

なお、アクティブマトリクス基板100Aの透明電極領域20および反射電極領域22のそれぞれの全体が平坦であることが好ましい。しかしながら、例えば、コンタクトホール6上で段差が形成される場合がある。この場合、厚さが異なる領域の面積が他の領域の全面積（例えば、反射電極領域の全面積）の10%以下であれば、表示品位の低下は視認されないので、許容できる。

【0041】

アクティブマトリクス基板100Aは公知の材料を用いて公知の方法で製造することができる。また、必要に応じて、アクティブマトリクス基板100Aの液晶層24側の表面に配向層（不図示）が形成される。

【0042】

液晶表示装置100の対向基板100Bは、図1(a)に示したように、ガラス等からなる透明絶縁性基板9の液晶層24側に、カラーフィルタ層10および光拡散層30とを有している。また、対向基板100Bは、液晶層24に電圧を印加するための单一の対向電極（不図示）をほぼ全面に有している。対向電極は、典型的には、カラーフィルタ層10の液晶層24側に設けられる。カラーフィルタ層10は、典型的には、赤(R)、緑(G)および青(B)の色層と、それらの間隙に設けられたブラックマトリクスとを有している（いずれも不図示）。このカラーフィルタ層10や対向電極（不図示）は公知の材料を用いて公知の方法で形成される。

【0043】

対向基板100Bが有する光拡散層30は、対向基板100Bのほぼ全面に形成されている。すなわち、対向基板100Bの反射領域Rfだけでなく透過領域Trにも形成されている。

【0044】

反射領域R_fに形成された光拡散層30は、液晶表示装置100に入射する周囲光を拡散することによって、ペーパーホワイトに近い白表示を実現する。また、透過領域T_rに形成された光拡散層30は、液晶表示装置100に入射する周囲光を拡散することによって、液晶表示装置100の透過領域T_rにおける表面反射を抑制し、ざらつきやぎらつきのない表示を実現することができる。すなわち、透過領域T_rに形成された光拡散層30は、アンチグレア効果を発揮する。

【0045】

光拡散層30は、図1(b)に示した液晶表示装置100'のように、液晶表示装置100'の反射領域R_fにのみ選択的に設けてもよい。この構成を採用すると、透過領域T_rを通過する光が拡散されることがないので、光の利用効率が向上する。透過領域T_rに光拡散層30を設けるか否かは液晶表示装置の用途に応じて適宜選択すればよい。なお、液晶表示装置100'は、対向基板100B'の光拡散層30が反射領域R_fにのみ設けられている点において、先に説明した液晶表示装置100と異なるだけなので、他の構成についての説明は省略する。

【0046】

上述したように光拡散層30を透明基板9の液晶層24側に設けることにより、透明基板9の厚さによる視差を抑制し、表示画像のぼやけを抑制することができる。

【0047】

光拡散層30は、透明なマトリクス材料（例えば、アクリル系樹脂）に、マトリクス材料の屈折率と異なる屈折率を有する充填剤（フィラー）を分散させた材料を用いて形成することが好ましい（以下、このように形成された光拡散層を「分散系光拡散層」と称す。）。透明な材料（例えば、SiO₂などの無機系材料）からなる薄膜の表面をサンドブラスタなどで粗面化処理した材料を用いる（以下、「粗面化光拡散層」と称す。）構成と比較し、分散系光拡散層は均一な厚さに形成しやすく、液晶層24の厚さのばらつきを抑制する効果が大きいので好ましい。さらに、表面が平坦な分散系光拡散層30は、表面に凹凸を有する粗面化光拡散層よりも、後方散乱に対する前方散乱の割合を大きくできるので、後方散

乱による白ひかり（拡散層が明るく視認される現象）が抑制され、高コントラスト比で明るい表示が実現される。

【0048】

分散系光拡散層30を形成するマトリクス材料および充填剤はともに無色透明であることが好ましい。透明基板9の液晶層30側に設けられる光拡散層30は、液晶表示装置100および100'の製造プロセスにおいて、熱処理工程や、化学処理工程を経るので、これらの工程に対して十分な安定性を有するマトリクス材料および充填剤を用いることが好ましい。具体的には、200℃以上の耐熱性、水、弱アルカリ、イソプロピルアルコール（IPA）などの化学薬品に対する安定性を備えていることが好ましい。

【0049】

分散系光拡散層30を形成するマトリクス材料としは、種々の高分子材料（例えば、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、アミノ樹脂）を好適に用いることができる。図1（b）に示したように、反射領域Rfに選択的に光拡散層30を形成する場合には、一旦全面に形成した光拡散層30をフォトリソグラフィプロセスを用いてパターニングすることが生産性の観点から好ましく、感光性や現像性（エッチング性）を有する材料を用いることが好ましい。

【0050】

充填剤としては、シリカなどの無機充填剤や、ポリイミドやポリサルファンなどの有機充填剤を用いることができる。また、充填剤としては、平均粒径が0.5 μm～2.0 μmの粒子状の充填剤が好ましい。平均粒径が0.5 μmよりも小さいと光拡散性能が低下することがあり、2.0 μmを越えると、光拡散層の膜厚の制御が困難になったり、拡散層の表面の平坦性が低下することがある。充填剤の添加量は、マトリクス材料との屈折率差にも依存し、十分な光拡散性および光透過率が得られる範囲で適宜設定すればよい。充填剤の添加量が多すぎると、光拡散層の光拡散性は上昇すが、光拡散層自体の光透過率が低下する。十分に明るい表示を実現するためには、光拡散層自体の透過率（可視光領域）は、90%以上あることが好ましい。光拡散層の厚さは、十分な光拡散性能を得るために

、 $1 \mu\text{m}$ ～ $8 \mu\text{m}$ の範囲内にあることが好ましい。上述した光拡散層の透過率は、実際に形成する光拡散層の厚さに対する値である。なお、上記の透過率は、光散乱層の後方から完全拡散光を入射し、光拡散層を透過した光を、光拡散層の法線方向において集光角 2° で受光することによって求められた透過光量の光拡散層が無い場合に求められた入射光量との百分率として求めた。透過率の測定は、例えば、TOPCON社製の輝度計BM7を用いて測定することができる。

【0051】

光拡散層30は、公知の薄膜形成方法を用いて形成することができる。例えば、上述した樹脂と充填剤とを溶媒に溶解・分散した溶液をスピンドルコート法を用いて基板上に塗布してもよいし（コーティング法）、充填剤が分散された樹脂のドライフィルムを基板上に貼り付けてもよい（フィルム貼り付け法）。

【0052】

光拡散層30は、種々の位置に設けることができる。図3を参照しながら、光拡散層30を設ける位置の例を説明する。

【0053】

光拡散層30は、図3（a）に示したように、透明基板40とカラーフィルタ層42との間に設けても良いし、図3（b）に示したように、カラーフィルタ層42と対向電極44との間に設けてもよく、さらに、図3（c）に示したように、対向電極44と配向層46との間に形成してもよい。また、図3（a）～（c）に示した上記の3つの層構造において、カラーフィルタ層42と対向電極44とが入れ代わってもよい。

【0054】

これらの光散乱層30を上述した分散系材料を用いて形成すると、表面粗さ（厚さのばらつき）が液晶層の厚さの10分の1以下（例えば、 $0.15 \mu\text{m}$ 以下）の光散乱層30を容易に形成することができる。液晶層の厚さは、表示モード（用いる液晶材料）によって異なるが、一般に $1.5 \mu\text{m}$ ～ $10 \mu\text{m}$ 程度の範囲にがあるので、分散系光散乱層を用いることにより、それぞれの表示モードに応じた最適な液晶層厚さを均一に有する液晶表示装置を容易に実現することができる。

【0055】

また、分散系材料を用いて形成された光拡散層30の平坦な表面においては散乱（後方散乱）がほとんど発生せず、光散乱層30の内部で効果的に散乱（前方散乱）される。その結果、コントラスト比の高い表示を反射モードで実現することができる。また、図3(c)に示した配置においては、光拡散層30が電気的絶縁層として利用することができる。すなわち、STN型液晶表示装置などにおいて駆動用電極と配向層との間に形成されるオーバーコート層として、光拡散層を利用することができる。

【0056】

光拡散層30をカラーフィルタ層（典型的には厚さ $1\text{ }\mu\text{m}\sim 2\text{ }\mu\text{m}$ ）に隣接させて（上または下に）配置すると、カラーフィルタ層と光拡散層との間の視差はほとんど無く、像の2重写りや画像のぼやけは発生せず、高品位の表示を実現することができる。また、反射板の表面に凹凸を設ける必要が無いので、従来の反射板の表面に凹凸を形成する構成において発生した、凹凸によって反射された光が互いに干渉し、この干渉がアンチグレア膜を介することによって顕著になり、ざらついた表示に観察される、という現象の発生も抑制される。

【0057】

次に、液晶表示装置100および100'の液晶層24の厚さ（「セルギャップ」とも言う。）の制御について説明する。

【0058】

液晶表示装置100および100'の反射領域Rfにおける液晶層24の厚さdrは、透過領域Trにおける液晶層24の厚さdtの1/2に設定されている。これは、反射モードの表示に利用される周囲光は、図1中の上側（対向基板100Bおよび100B'側）から入射し、液晶層24を通過した後、金属層23で反射され、再び液晶層24を通過した後、対向基板100Bおよび100B'から出射されるので、液晶層24を2回通過する。従って、反射領域Rf内の液晶層24の厚さdrを透過領域Trの液晶層24の厚さdtの1/2とすることによって、反射モードの表示に利用される光と透過モードの表示に利用される光の光路長を一致させることができる。液晶層24による偏光方向の変化（回転）

を利用して表示を行うモード（例えば、TNモード、STNモード、垂直配向モードを含む ECB モード）では、それぞれの絵素領域 P_x において、反射領域 R_f を通過した光の偏光方向と、透過領域 T_r を通過した光の偏光方向とを互いに一致させることによって、高品位の表示を実現することができる。

【0059】

上述した液晶層 24 の厚さの条件を十分に満足させるためには、透過領域 T_r および反射領域 R_f のそれぞれにおいて、液晶層 24 の厚さ (d_t および d_r) が一定であることが好ましい。本発明による液晶表示装置 100 および 100' が有するアクティブマトリクス基板 100A は、上述したように、透過電極領域 20 および反射電極領域 22 の液晶層 24 側の表面は平坦であり、且つ、対向基板 100B および 100B' に設けられた光拡散層 30 の液晶層 24 側表面も平坦であるので、液晶層 24 の厚さは、透過領域 T_r および反射領域 R_f のそれぞれにおいて一定であり、高品位の表示を実現することができる。

【0060】

具体的には、本発明の液晶表示装置 100 および 100' の液晶層 24 の透過領域 T_r および反射領域 R_f のそれぞれにおける厚さのばらつきは、標準偏差 σ (面内 25 点の厚さを測定) で 0.03 ~ 0.05 と非常に小さな値が得られる。一方、上述した特開平 11-101992 号公報に開示されている凹凸表面を有する反射板を用いた液晶表示装置の反射領域における液晶層のばらつきは、標準偏差 σ が 0.12 ~ 0.15 と大きく、液晶層の厚さの 10 分の 1 を超えるものもある。このことから分かるように、本発明による透過反射両用型の液晶表示装置 100 および 100' は、従来のものよりも高品位の表示を実現することができる。

【0061】

次に、図 4 (a) および (b) を参照しながら、本発明による液晶表示装置 200 および 200' の液晶層 24 の厚さ (セルギャップ) の制御方法を説明する。

【0062】

液晶表示装置 200 および 200' は、それぞれのアクティブマトリクス基板

200Aが、図1(a)および(b)に示したアクティブマトリクス基板100Aの金属層23に代えて、絶縁層48とその上に形成された金属層23'を有している点において、液晶表示装置100および100'に異なる。液晶表示装置200および200'のその他の構成要素は、それぞれ液晶表示装置100および100'の構成要素と実質的に同じなので、同一の参照符号をその説明をここでは省略する。

【0063】

図4(a)に示した液晶表示装置200のように、光拡散層30が対向基板100Bのほぼ全面に形成されている場合、絶縁層48の厚さ(D1)とスペーサ52の直径(D2)とを等しくすれば、下記の式(1)に示すように、反射領域Rfにおける液晶層24の厚さdr (=D2)を透過領域Trにおける液晶層24の厚さdtの1/2とすることができます。なお、金属層23'の厚さは絶縁層48の厚さに比べ非常に薄いので無視できる。

【0064】

$$D1 + D2 = dt \quad (D1 = D2 = dr) \quad \dots (1)$$

一方、図4(b)に示した液晶表示装置200'のように、光拡散層30が反射領域Rfにのみ選択的に形成されている場合、下記の式(2)に示すように、スペーサ52の直径D2が、絶縁層48の厚さD1' と光拡散層30の厚さD3との和に等しくなるように設定すれば、反射領域Rfにおける液晶層24の厚さdr (=D2)を透過領域Trにおける液晶層24の厚さdtの1/2とすることができる。

【0065】

$$D1' + D2 + D3 = dt \quad (D1' + D3 = D2 = dr) \quad \dots (2)$$

なお、上記の関係は理想的な設計上の関係であり、実際に液晶セルを製造すると、加工精度の影響で、上記の関係が満足されないことがある。しかしながら、反射領域Rfにおける液晶層24の厚さdrと透過領域Trにおける液晶層24の厚さdtがそれぞれ設計値の15%のずれ範囲内であれば、従来よりも高品位の表示を実現することができる。

【0066】

以下に、本実施形態の液晶表示装置で用いられる光拡散層30および反射電極領域22の他の構成例を説明する。反射電極領域22は、実施形態1の液晶表示装置100および200で例示したように、単一の金属層23を用いて形成してもよいし、絶縁層48とその上に形成された金属層23'を用いて形成してもよい。それぞれ、金属層23の厚さまたは絶縁層48の厚さを調節することによって、反射領域Rf内の液晶層24の厚さを調整することができる。以下では、簡単のために、透過電極領域20および反射電極領域22の詳細な構造の説明を省略する。また、以下の図面において、実施形態1の液晶表示装置の構成要素と実質的に同じ機能を有する構成要素と同じ参照符号で示し、ここでの説明を省略する。

【0067】

図5に示す液晶表示装置300は、図1(b)に示した液晶表示装置100' と同様に、反射領域Rfにのみ選択的に光拡散層30が形成されている。但し、反射領域Rf内の液晶層24の厚さは、光拡散層30の厚さで調整されている。この液晶表示装置300は、液晶表示装置100' と同様に、透過領域Trには光拡散層30が形成されていないので、透過領域Trを通過する光が拡散されることによって生じる光のロスがなく、光の利用効率が向上する。

【0068】

図6に示す液晶表示装置400は、反射領域Rfに選択的に形成された光拡散層30と透過領域Trに選択的に形成された透明層54とを有している。透明層54は、光拡散層30と同じ厚さを有しており、平坦な面を形成している。この光拡散層30および透明層54とが形成する平坦な面上にカラーフィルタ層10が形成されている。反射領域Rf内の液晶層24の厚さは、反射電極領域22の厚さで調整される。透明層54は、分散系光拡散層のマトリクス材料と同様に、例えば、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂を用いて形成することができる。この構成は、光拡散層が設ける基板(観察者側基板)の液晶層側表面が平坦なので、液晶層の厚さの制御が比較的容易であるという利点を有している。

【0069】

図7に示す液晶表示装置500が有するカラーフィルタ層60は、光を拡散す

る機能を有する光拡散カラーフィルタ領域60aと、通常のカラーフィルタ領域60bとを有している。光拡散カラーフィルタ領域60aは、反射領域Rfに対応して選択的に設けられている。このように、カラーフィルタ層60の一部に光拡散機能を付与することによって、構造を単純化することができる。光拡散カラーフィルタ層60aは、通常のカラーフィルタ層を形成する材料中に、屈折率の異なる充填剤を分散した材料を用いて形成することができる。例えば、一般的なカラーフィルタ層用材料に、粒径が1μmの粒子状充填剤（例えば、シリカ）を30wt%添加した分散系材料を用いて、厚さ約1.7μmのカラーフィルタ層を形成することによって、光拡散カラーフィルタ層60aを形成することができる。光拡散カラーフィルタ層60aは、充填剤を分散させていないカラーフィルタ層60bと同等の表面平滑性と膜厚均一性を有している。

【0070】

勿論、図8に示した液晶表示装置600のように、対向基板のほぼ全面に光拡散カラーフィルタ層60aを有するカラーフィルタ層60'を設けても良い。光拡散カラーフィルタ層60aを反射領域Rfに選択的に設けるか全面に設けるかの選択は、光拡散層30の場合と同様に、液晶表示装置の用途に応じて適宜選択すればよい。

【0071】

図9に示す液晶表示装置700は、対向基板側のガラス基板62が凹凸表面（光拡散層）64を有している。ガラス基板（例えば、#1737：コーニング社製）62の表面の、反射領域Rfに対応する領域に、ランダムな凹凸が選択的に形成されている。このランダムな凹凸は、たとえば、サンドブラスト法によって形成することができる。サンドブラスト法を用いて形成された凹凸は、面内の大きさ（直径に近似できる）が約2～5μmの範囲内で、深さが約0.5～1μmの範囲内にあり、その中心の面内の分布はランダムである。また、凹凸が形成されたガラス基板62の表面に、ガラス基板62の屈折率と異なる屈折率を有する平坦化膜（例えば、SiO₂からなる）を設けることによって、光を拡散する能力が向上する。このような構成においては、ガラス基板62の凹凸表面および、凹凸表面と平坦化膜（不図示）との組合せが、光拡散層として機能する。なお

、図9に示した例では、光拡散層64は反射領域Rf内に選択的に形成されているが、上述した他の構成と同様に、基板のほぼ全面に、光拡散層64を形成してもよい。また、ガラス基板62に代えて、プラスチック基板を用いてもよい。

【0072】

また、図10に示す液晶表示装置800のように、偏光機能付プラスチック基板70を用いることによって、対向基板側の偏光板（不図示）を省略し、構造を簡略化することができる。なお、プラスチック基板70はその製法上の理由からリタデーションを有することが多く、コントラスト比の観点から、リタデーション（位相差）ができるだけ小さいプラスチック基板を用いることが好ましい。液晶表示装置800は、偏光機能付の基板70を用いたこと以外は、実施形態1の液晶表示装置100と同じ構造を有している。偏光機能を有するプラスチック基板70は、上述した他の液晶表示装置にも用いることができる。

【0073】

図11に示す液晶表示装置900のように、対向基板に用いられる透明絶縁性基板に光拡散機能を有するものを用いることもできる。液晶表示装置900が有するプラスチック基板80は、充填剤を分散させた高分子材料から形成されており、光拡散機能を有する。プラスチック基板80は、例えば、PET樹脂やPES樹脂（マトリクス材料）に、シリカ系の粒子状充填剤（平均粒径1μm）を15～20wt%分散させた材料を用いて形成される。

【0074】

図7～図9および図11に示した液晶表示装置は、別途光拡散層を形成する必要がないので、実施形態1の液晶表示装置の有する利点に加えて、製造プロセスを簡略化できる（製造コストを低減できる）という利点や、液晶表示装置を薄くできるという利点を有している。また、図10の液晶表示装置800が有する偏光機能付プラスチック基板を用いることによって、偏光板を1枚省略することができ、製造プロセスの簡略化および液晶表示装置の薄型化をさらに進めることができる。

（実施形態2）

実施形態2の液晶表示装置は、第1基板（バックライト側）に液晶層を間に介

して対向するように配設された第2基板（観察者側）の外側（観察者側）に光拡散層が配置されている点において、実施形態1の液晶表示装置と異なる。実施形態2の液晶表示装置を示す図面において、実施形態1の液晶表示装置の構成要素と実質的に同一の機能を有する構成要素には同一の参照符号を付し、その説明をここでは省略する。

【0075】

本発明による実施形態2の液晶表示装置1000および1000'の模式的な断面構造を図12(a)および(b)に示す。図12(a)および(b)に示した液晶表示装置1000および1000'はそれぞれ、図4(a)および(b)に示した液晶表示装置200および200'の光拡散層30を透明基板9の外側（観察者側）に配置したものに相当する。

【0076】

なお、図12(b)に示したように、光拡散層30を反射領域Rfに対応して選択的に設け、且つ、光拡散層30を透明基板9の外側に設ける構成においては、光拡散層30を反射領域Rfよりもやや大きく形成することが好ましい。すなわち、金属層23'に斜め入射する光、あるいは金属層23'から斜め出射される光のほとんどが光拡散層30を通過するように、光拡散層30と金属層（反射層）23'との距離が透明基板9の厚さ分（例えば、0.7mm）増加するのに伴って、光拡散層30の面積を大きくすることが好ましい。反射領域Rfに対応して設けられる光拡散層23'の広さは、液晶表示モード等も考慮して適宜設定され得る。

【0077】

液晶表示装置1000および1000'は、透明基板9の内側に光拡散層30を設けた実施形態1の液晶表示装置200および200'に比較し、製造が容易で、設計変更や共用化に対応しやすく、低コストで製造できるという利点がある。すなわち、基板100Aおよび100Bを貼り合わせ工程や液晶注入工程を経た後、透明基板9の外側表面に光拡散層30を形成すればよいので、光拡散層30の形成工程によって、液晶表示装置の製造歩留まりが低下する事がない。また、光拡散層30は、実施形態1と同様に種々の方法で形成することができるが

、特に、光拡散層30をフィルムを用いて形成する場合、光散乱層用のフィルムを種々のタイプの（例えばパネルサイズが異なる）液晶表示装置に共通に用いることができるし、液晶表示装置の設計変更に容易に対応することができる。

【0078】

製造工程を簡略化できる効果（低コスト化の効果）は、液晶表示装置1000のように表示領域全体に光拡散層30を設けた構成の方が、液晶表示装置100'のように選択的に光拡散層30を設けた構成よりも高い。特に、図13に示した液晶表示装置1100のように、一対の偏光板90aおよび90bを備える液晶表示装置においては、透明基板9の外側に設けられる偏光板90aを透明基板9に接着するための接着剤に光散乱機能を有する材料を用いることによって、光散乱層30aを接着層として用いることができる。また、画像表示のぼやけをできるだけ抑制するためにも、光拡散層30は透明基板9に隣接して配置することが好ましく、表示画像のぼやけを抑制するという観点からも、光拡散層30aを偏光板90aと透明基板9との接着層として利用する構成は効果的である。

【0079】

接着剤として機能し得る光拡散層の材料としては、種々の樹脂系接着剤（マトリクス材料となる）に充填剤を添加した、分散系材料を好適に用いることができる。樹脂系接着剤としては、例えば、フェノール系接着剤、アクリル系接着剤、ポリイミド系接着剤、エポキシ系接着剤やシリコン系接着剤を用いることができる。充填剤としては、実施形態1の分散系光散乱層用の充填剤と同様の材料を広く用いることができる。

【0080】

図14に本実施形態の他の液晶表示装置1200の模式的な断面図を示す。液晶表示装置1200は、図9に示した実施形態1の液晶表示装置700の光拡散層64（凹凸表面）が、ガラス基板62の外側に形成されている。液晶表示装置1200は、液晶表示装置700と実質的に同様の方法で形成することができる。

【0081】

なお、図12に示したように、光拡散層64を反射領域Rfに対応して選択的に設ける構成においては、図12(b)に示した液晶表示装置1000'の光拡散層30と同様に、反射領域Rfに対する光拡散層64の面積を反射領域Rfの面積よりも大きくすることが好ましい。

【0082】

また、凹凸が形成されたガラス基板62の表面に、ガラス基板62の屈折率と異なる屈折率を有する平坦化膜（例えば、 SiO_2 からなる）を設けることによって、光を拡散する能力が向上する。このような構成においては、ガラス基板62の凹凸表面および、凹凸表面と平坦化膜（不図示）との組合せが、光拡散層として機能する。ガラス基板62の外側に偏光板を有する構成においては、偏光板（不図示）をガラス基板62の外側表面に接着するための接着層の材料として、ガラス基板62の屈折率と異なる屈折率を有する透明な材料を用いることによって、接着層を上記平坦化膜として機能させることができる。

【0083】

なお、図14に示した例では、光拡散層64は反射領域Rfに対応して選択的に形成されているが、上述した他の構成と同様に、基板のほぼ全面に、光拡散層64を形成してもよい。また、ガラス基板62に代えて、プラスチック基板を用いてもよい。

【0084】

上述の実施形態の液晶表示装置が備えるアクティブマトリクス基板と対向基板との組み合わせは、適宜変更することができる。また、上記の実施形態では、TFT（薄膜トランジスタ）を用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置を例示したが、本発明はこれに限られず、MIM素子を用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置や単純マトリクス型液晶表示装置など、他の液晶表示装置にも適用できる。

【0085】

【発明の効果】

本発明による液晶表示装置を構成する一対の基板の液晶層側の表面は、反射領域および透過領域のそれぞれの領域内で、平坦なので、それぞれの領域内の液晶

層は一定の厚さを有する。従って、反射領域および透過領域のそれぞれの領域の液晶層の厚さをそれぞれの表示モードに最適の厚さに設定することができる。偏光モードの表示を行う液晶表示装置においては、反射領域の液晶層の厚さを透過領域の液晶層の厚さの2分の1とすることによって、高品位の表示を実現することができる。

【0086】

対向基板の反射領域に設けられる光拡散層は、反射領域に入射する光を拡散するので、ペーパホワイトの白表示を実現することができる。また、対向基板の透過領域に光拡散層を形成すると、透過領域を透過する光が拡散されることによつて、液晶表示装置の透過領域における表面反射が抑制され、ざらつきやぎらつきのない表示を実現することができる。一方、透過領域に光拡散層を設けない構成においては、透過領域における光の利用効率が向上する。

【0087】

光拡散層をマトリクス中に粒子を分散した材料を用いて形成すると、表面が平坦な光拡散層を容易に形成できるとともに、反射領域の液晶層の厚さを容易に且つ正確に制御することができる。マトリクス材料に、マトリクス材料の屈折率と異なる屈折率を有する粒子（充填剤）を分散した材料を用いて、カラーフィルタ層やプラスチック基板を形成することによって、カラーフィルタ層やプラスチック基板を光拡散層として機能させることができとなり、液晶表示装置の製造プロセスを簡略化することができる。

【0088】

このように、本発明によると、液晶層の厚さ、特に反射領域内の液晶層の厚さを正確に制御することが可能で、高品位の表示を実現できる透過反射両用型の液晶表示装置が提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】

(a) は、本発明による実施形態1の液晶表示装置100の模式的な断面図であり、(b) は実施形態1の他の液晶表示装置100'の模式的な断面図である。

【図2】

実施形態1の液晶表示装置100および100'が有するアクティブマトリクス基板100Aを模式的に示す平面図である。

【図3】

(a)～(c)は、実施形態1の液晶表示装置に用いられる光拡散層30の配置の例を模式的に示す断面図である。

【図4】

(a)は、本発明による実施形態1の他の液晶表示装置200の模式的な断面図であり、(b)は実施形態1の液晶表示装置200'の模式的な断面図である。

【図5】

本発明による他の実施形態の液晶表示装置300の模式的な断面図である。

【図6】

本発明による他の実施形態の液晶表示装置400の模式的な断面図である。

【図7】

本発明による他の実施形態の液晶表示装置500の模式的な断面図である。

【図8】

本発明による他の実施形態の液晶表示装置600の模式的な断面図である。

【図9】

本発明による他の実施形態の液晶表示装置700の模式的な断面図である。

【図10】

本発明による他の実施形態の液晶表示装置800の模式的な断面図である。

【図11】

本発明による他の実施形態の液晶表示装置900の模式的な断面図である。

【図12】

(a)は、本発明による実施形態2の液晶表示装置1000の模式的な断面図であり、(b)は実施形態2の液晶表示装置1000'の模式的な断面図である。

【図13】

本発明による実施形態2の他の液晶表示装置1100の模式的な断面図である

【図14】

本発明による実施形態2の他の液晶表示装置1200の模式的な断面図である

【符号の説明】

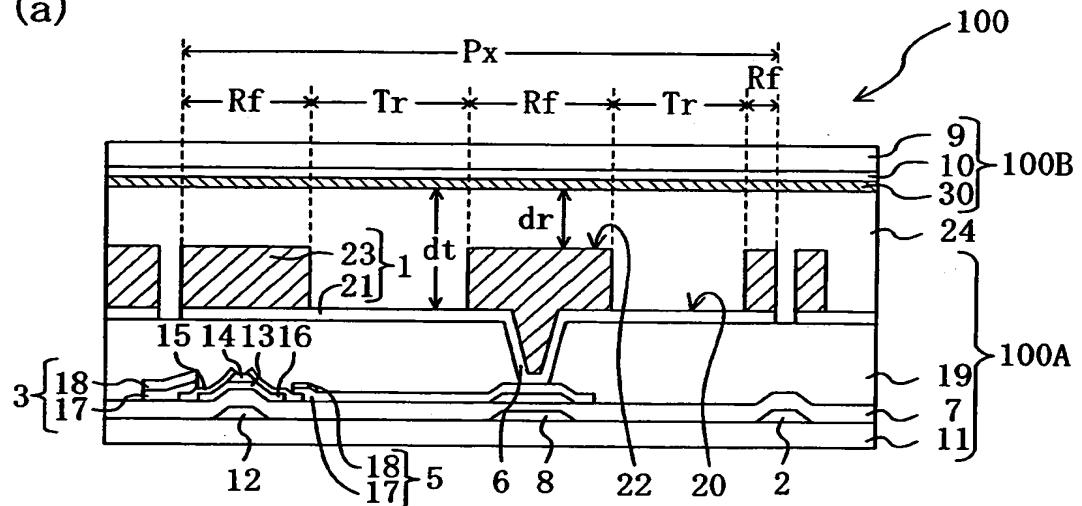
- 1 絵素電極領域
- 2 ゲート配線
- 3 ソース配線
- 4 TFT
- 5 接続電極
- 6 コンタクトホール
- 7 ゲート絶縁膜
- 8 補助容量電極
- 10、42、60、60' カラーフィルタ層
- 11、40、62 透明絶縁性基板
- 12 ゲート電極
- 13 半導体層
- 14 チャネル保護層
- 15 ソース電極
- 16 ドレイン電極
- 17 透明導電層
- 18 金属層
- 19 層間絶縁膜
- 20 透明電極領域
- 21 透明電極
- 22 反射電極領域
- 23、23' 金属層
- 24 液晶層

30 光拡散層
44 対向電極
46 配向層
48 絶縁層
52 スペーサ
54 透明層
60a 光拡散カラーフィルタ層
60b 通常のカラーフィルタ層
64 凹凸表面
70 偏光機能付プラスチック基板
80 光拡散機能付プラスチック基板
90a、90b 偏光板
100A、200A アクティブマトリクス基板
100B、100B' カラーフィルタ基板(対向基板)
100、100'、200、200'、300、400、 液晶表示装置
500、600、700、800、900 液晶表示装置
1000、1000' 1100、1200 液晶表示装置
Tr 透過領域
Rf 反射領域
Px 絵素領域

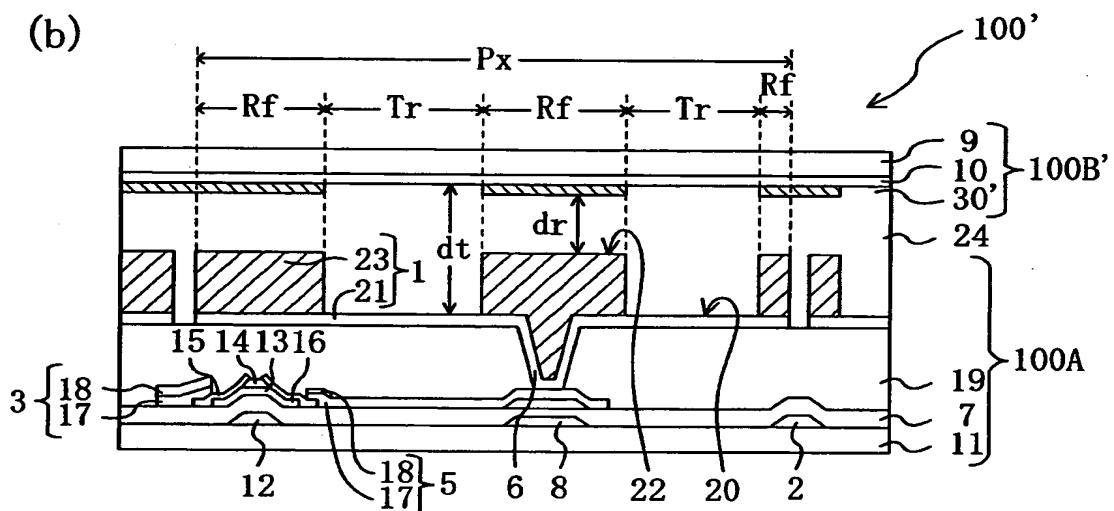
【書類名】 図面

【図1】

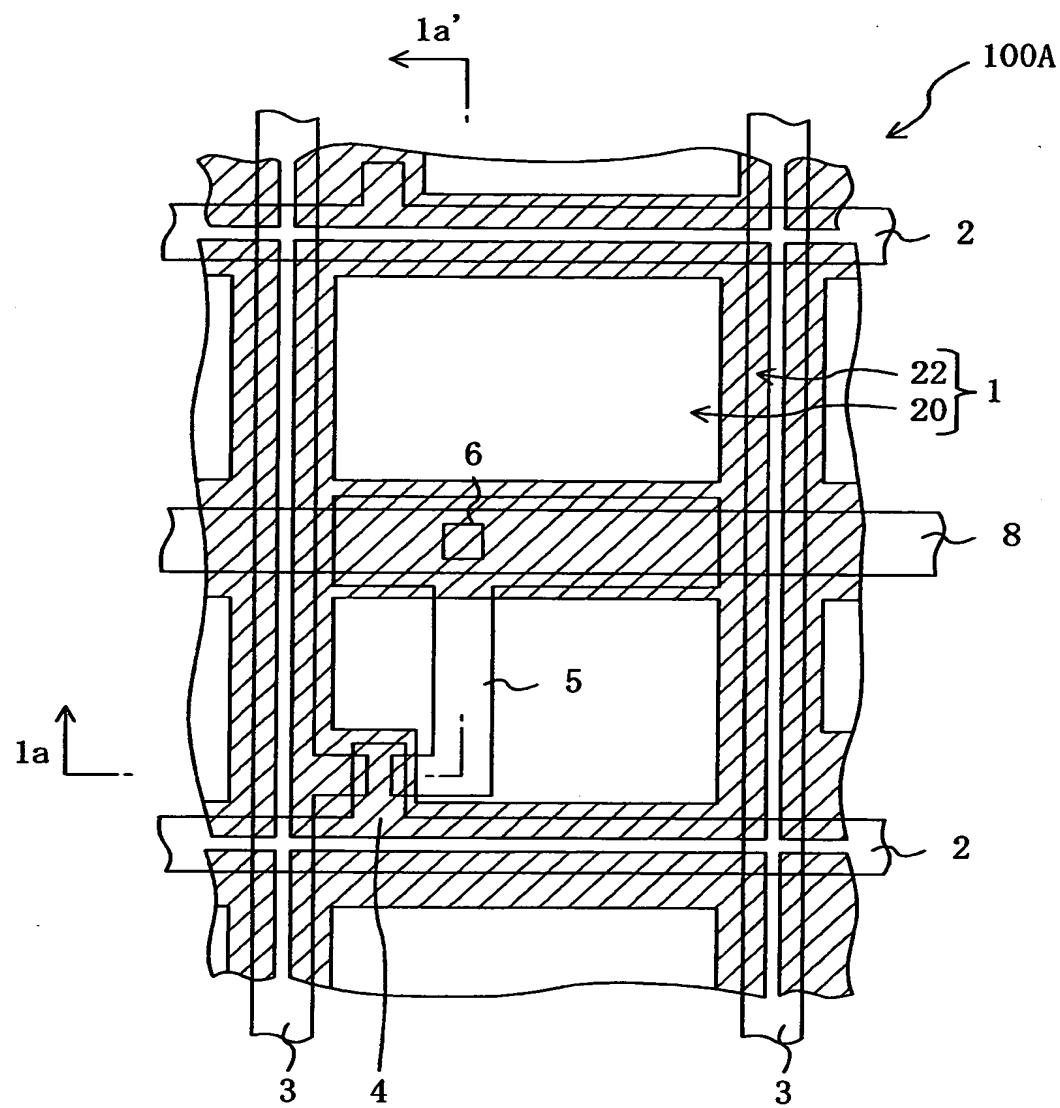
(a)



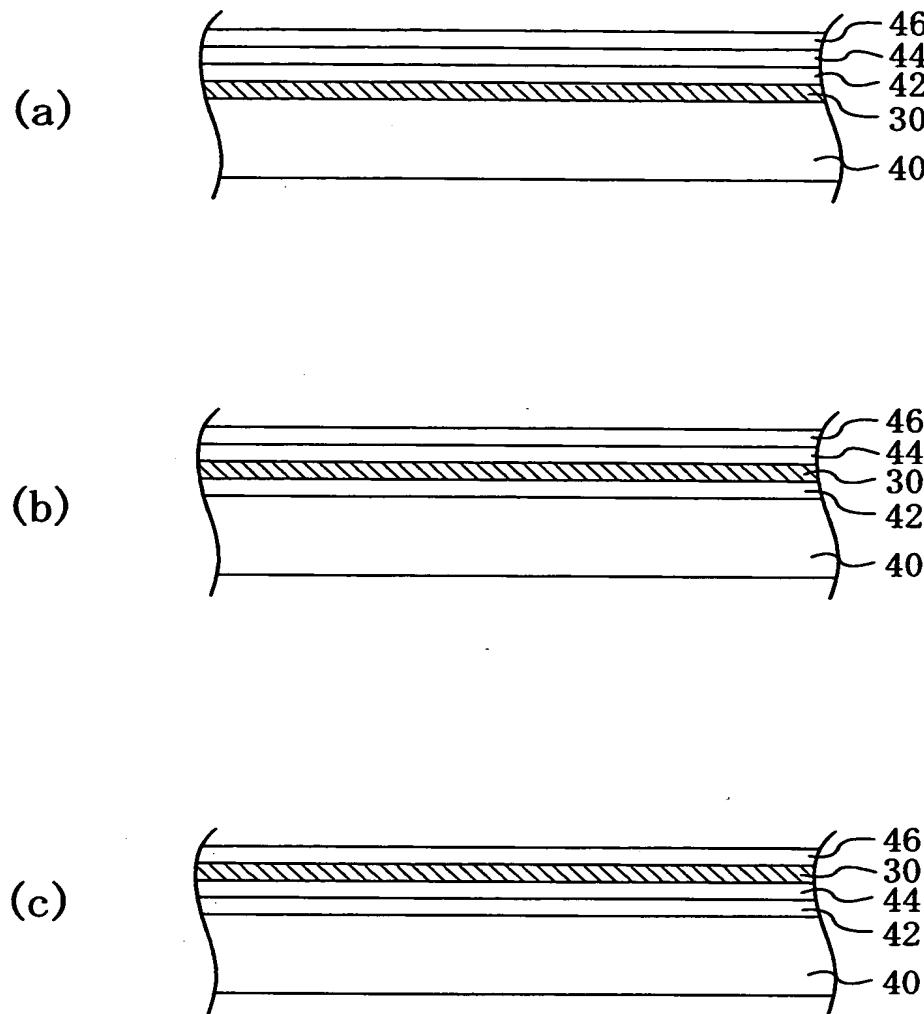
(b)



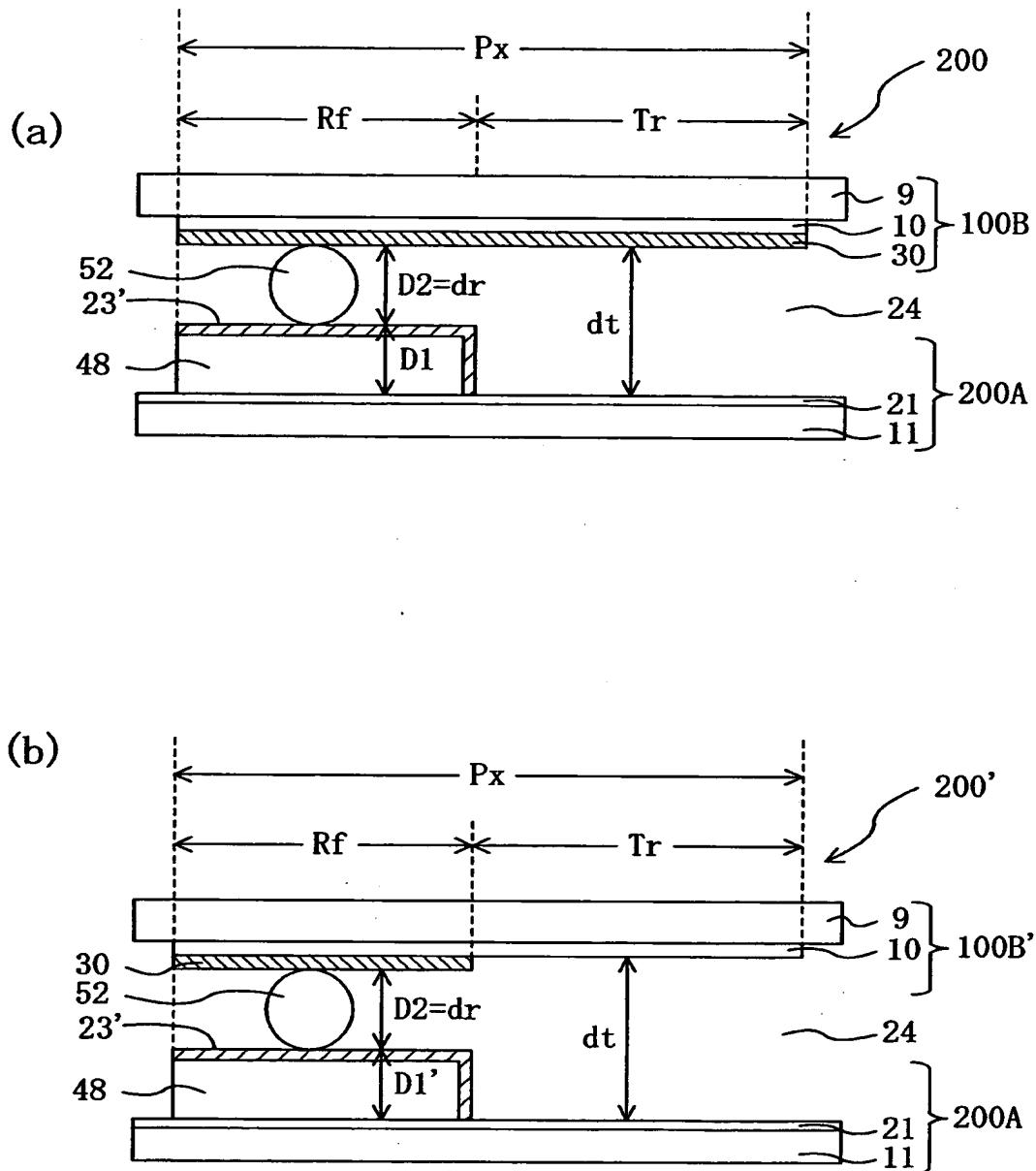
【図2】



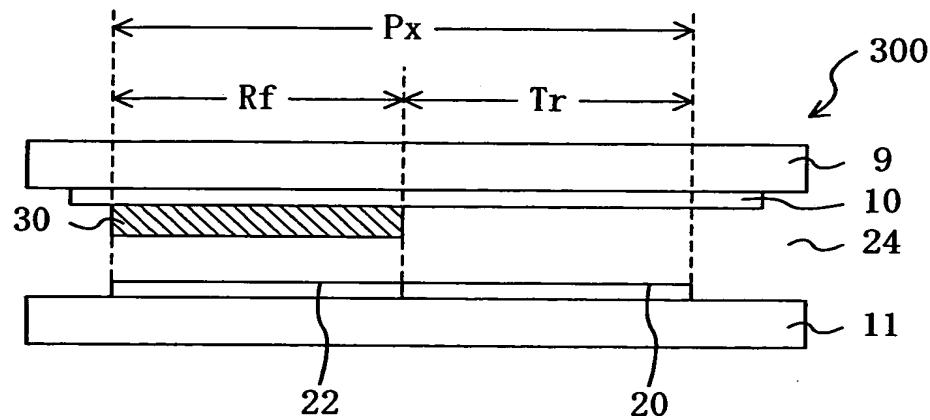
【図3】



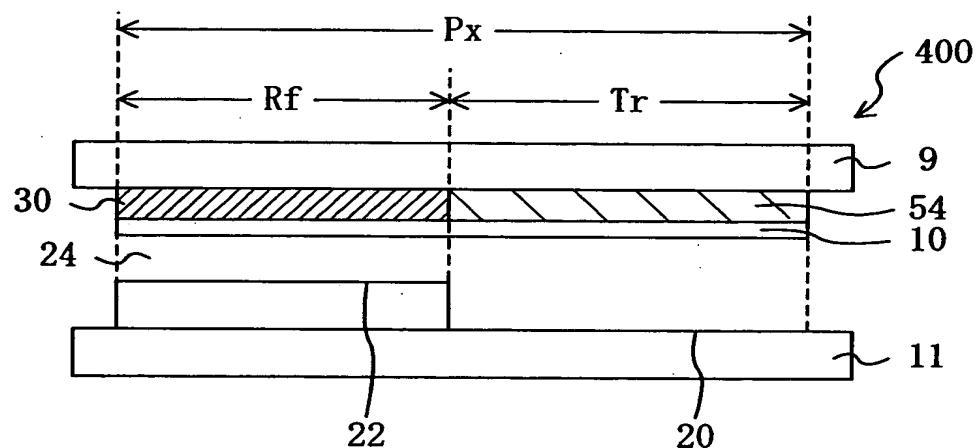
【図4】



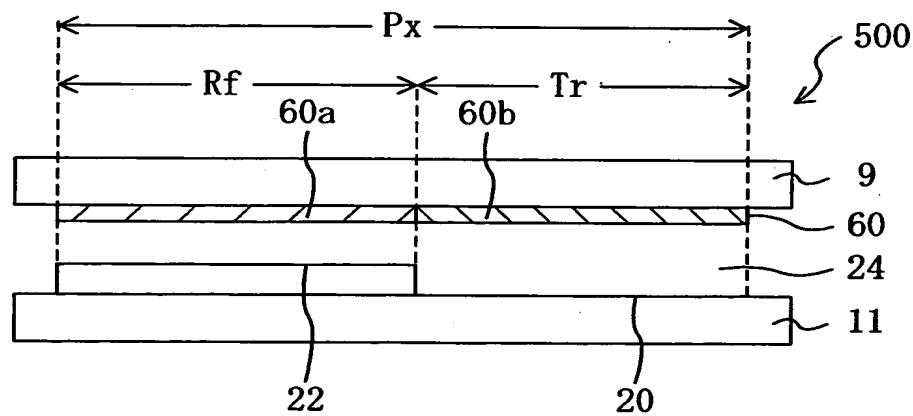
【図5】



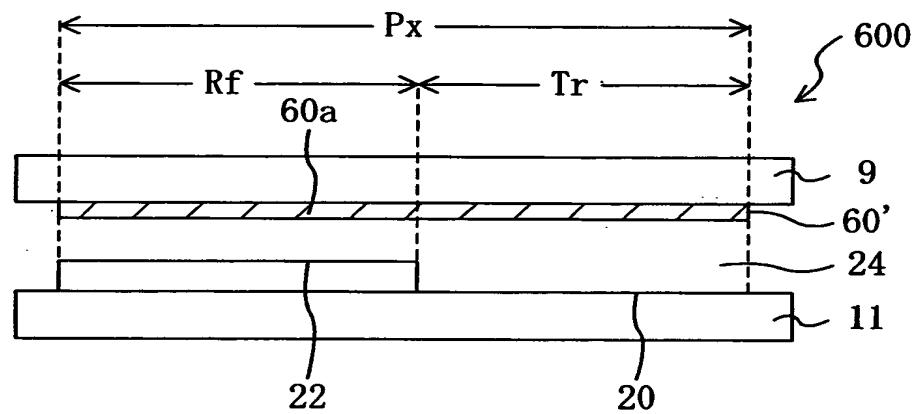
【図6】



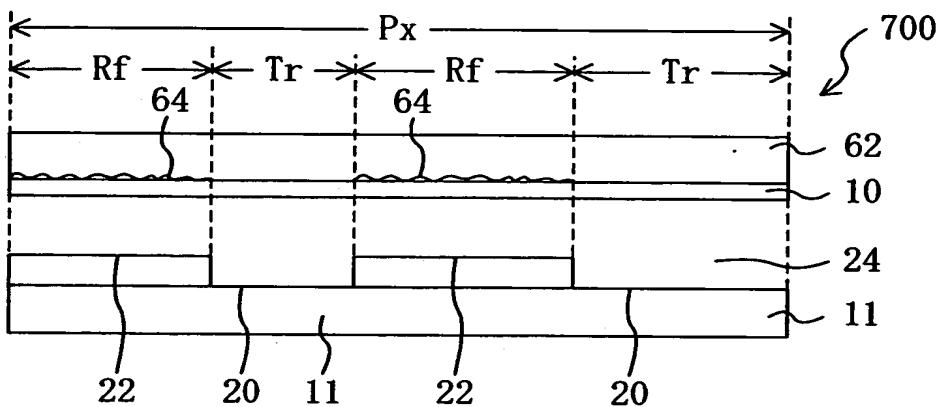
【図7】



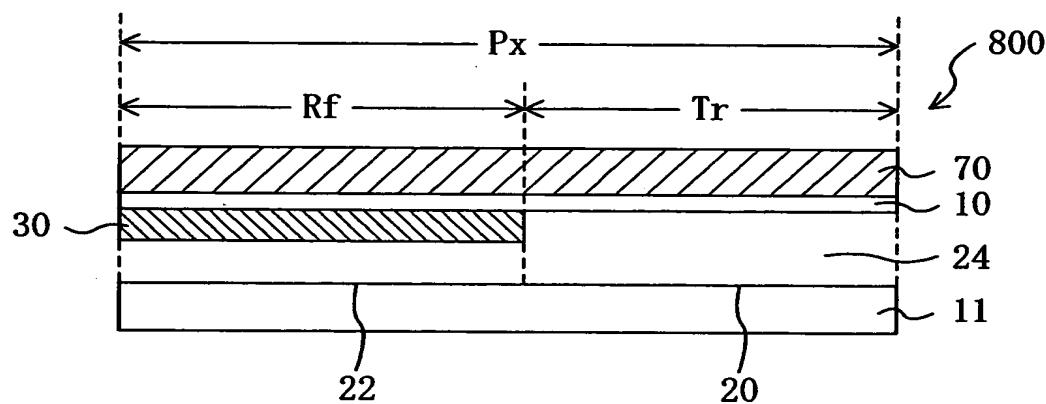
【図8】



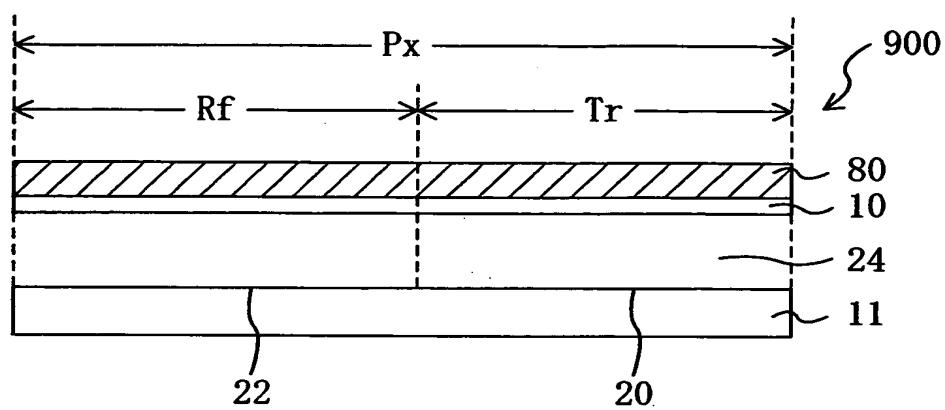
【図9】



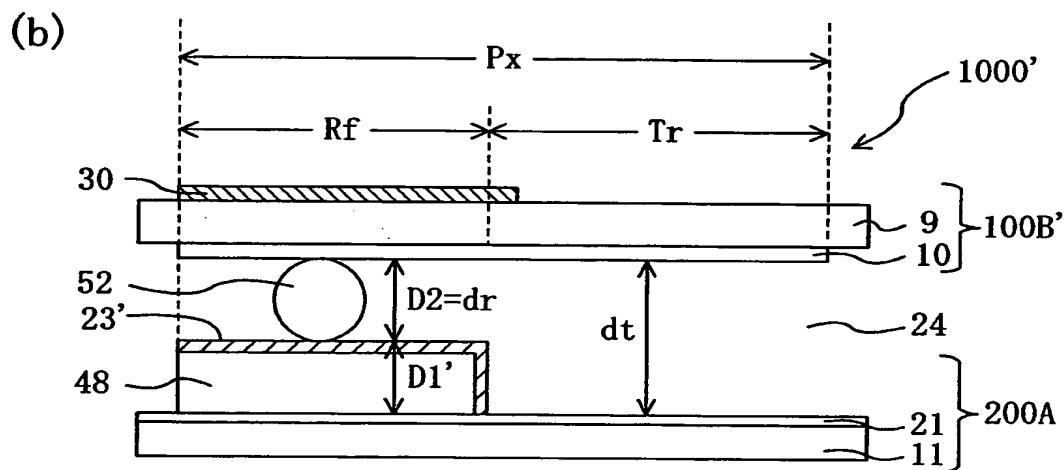
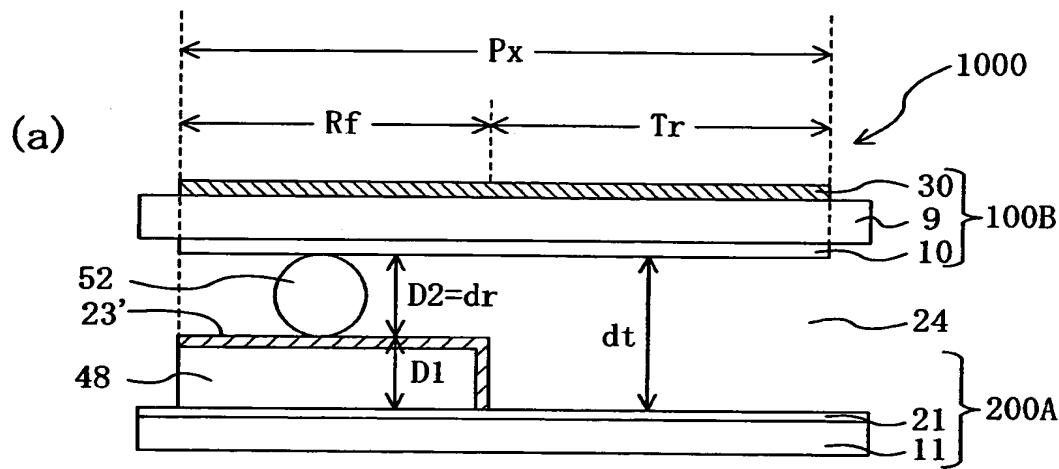
【図10】



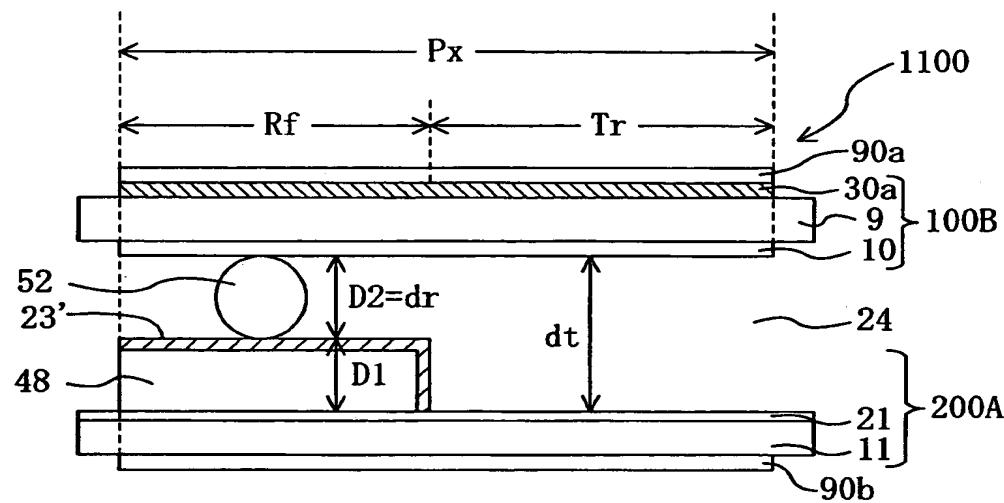
【図11】



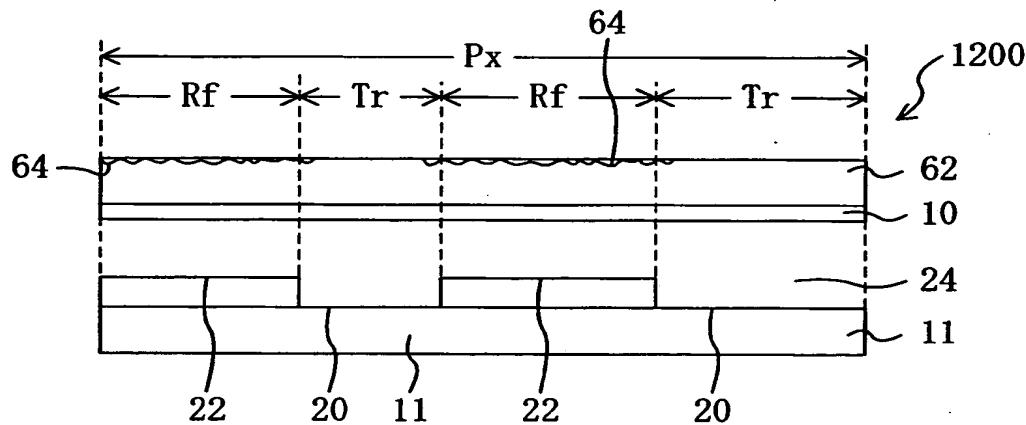
【図 1 2】



【図13】



【図14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 液晶層の厚さ、特に反射領域内の液晶層の厚さを正確に制御することが可能で、高品位の表示を実現できる透過反射両用型の液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 絵素領域 P x のそれぞれは、第1基板 100A から入射する光を用いて透過モードで表示を行う透過領域 T r と、第2基板 100B 側から入射する光を用いて反射モードで表示を行う反射領域 R f を有する。第1基板 100A が有する透明電極領域 20 および反射電極領域 22 の液晶層 24 側の表面はそれぞれ平坦である。第2基板 100B は、液晶層側の反射領域 R f および透過領域 T r に透明電極を有し、反射領域 R f に光拡散層 30 を有し、且つ、第2基板 100B の液晶層 24 側の表面は、透過領域内および反射領域内でそれぞれ平坦である。

【選択図】 図 1

出願人履歴情報

識別番号 [000005049]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
氏 名 シャープ株式会社